

VEREIN DEUTSCHER
INGENIEURE
VERBAND DEUTSCHER
ELEKTROTECHNIKERMaskentechnik
Strukturen

VDI/VDE 3717

Blatt 4 / Part 4
Entwurf / DraftMask Engineering
PatternAusg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**No guarantee can be given with respect to the English translation. The German version of this Guideline shall be taken as authoritative.**Einsprüche in doppelter Ausfertigung bis 31.08.1997 an
Objections in duplicate before 31/08/1997 to**Verband Deutscher Elektrotechniker
VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik
Stresemannallee 15
60596 Frankfurt/M.*

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung	3	Preliminary Note	3
1 Definitionen	3	1 Definitions	3
2 Bestellinformationen	3	2 Order Information	3
3 Absorberschichten	3	3 Absorption Layers	3
4 Strukturrichtigkeit und Maskenaufbau	4	4 Pattern Correctness and Mask Layout	4
5 Kantenqualität.	4	5 Edge Quality	4
6 Critical Dimension (CD).	4	6 Critical Dimension (CD)	4
6.1 Meßstruktur.	4	6.1 CD Pattern	4
6.2 Meßstandard	4	6.2 Measuring Standard	4
6.3 Toleranzen	4	6.3 Tolerances	4
7 Lagefehler/Überdeckbarkeit	5	7 Registration/Overlay	5
7.1 Meßstruktur.	5	6.1 CD Pattern	5
7.2 Meßstandard	5	6.2 Measuring Standard	5
8 Strukturfehler	6	8 Pattern Defects	6
8.1 Fehlerarten	6	8.1 Defect Types	6
8.2 Fehlergröße	6	8.2 Defect Size	6
8.3 Fehlerlage.	7	8.3 Defect Position	7
8.4 Fehleranzahl	7	8.4 Number of Defects	7

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikro- und Feinwerktechnik
Ausschuß Maskentechnik

VDI/VDE-Handbuch Mikro- und Feinwerktechnik